【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【公表番号】特表2004-534379(P2004-534379A)
【公表日】平成16年11月11日(2004.11.11)
【年通号数】公開・登録公報2004-044
【出願番号】特願2002-566530(P2002-566530)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/02　　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/205　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/02　　Ｚ
Ｈ０１Ｌ　21/205

【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年9月25日(2008.9.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１枚の基板を処理する装置であって、前記装置は、
処理環境内に基板を搬送すると共に、複数のフィンガを有する少なくとも1つの基板キャリヤと、
該少なくとも１つの基板キャリヤと選択的に連通している少なくとも１つの温度制御プレートと、
該処理環境内で該少なくとも１つの基板キャリヤの処理通路に近接して位置する少なくとも１つの堆積デバイスであって、該少なくとも１つの堆積デバイスは選択された膜を該基板上に堆積させるよう構成されている、前記少なくとも１つの堆積デバイスと、
を備える装置。
【請求項２】
前記少なくとも１つの基板キャリヤが、
平坦な基板を受け取る部材であって、該受け取り部材はその中に形成された複数の穴とその上に形成された基板受け取り面とを有する、平坦な基板を受け取る部材と、
該受け取り部材の下面上に位置する駆動係合部材と、
を更に備える、請求項１記載の装置。
【請求項３】
前記少なくとも１つの基板キャリヤが、前記処理環境内の第一点と前記処理環境内の第二点の間で基板を搬送するよう構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項４】
前記少なくとも１つの温度制御プレートが、
第一加熱デバイスと冷却デバイスのうちの少なくとも１つが形成されたプレートと、
該プレートの表面から伸長している複数の伸長ピン部材であって、該伸長ピン部材は前記少なくとも１つの基板キャリヤ内に形成された複数の穴を協同的に係合するよう構成されている、複数の伸長ピン部材と、
を更に備える、請求項１記載の装置。
【請求項５】

該第一加熱デバイスが熱電対と連通している少なくとも1つのヒータを更に備える、請求項４記載の装置。
【請求項６】
該冷却デバイスが、該プレート内に形成された、流体入力と流体出力を有する流体チャネルを更に備える、請求項４記載の装置。
【請求項７】
該プレートの該表面が、ビードブラスト表面と陽極処理表面のうちの少なくとも１つを更に備える、請求項４記載の装置。
【請求項８】
該基板がアニーリングされるよう該処理環境内に位置する第二加熱デバイスを更に備える、請求項１記載の装置。
【請求項９】
該第二加熱デバイスがレーザ光源を更に備える、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
該レーザ光源がエキシマレーザを更に備える、請求項９記載の装置。
【請求項１１】
該少なくとも１つの温度制御プレートが該少なくとも１つの基板キャリヤと熱的に連通している、請求項１記載の装置。